

グレイスケールリソグラフィセミナー & ワークショップ

ハイデルベルグ・インストルメンツのレーザー直接描画装置 GenISys のシミュレーションソフトウェア ナガセケムテックスのグレイスケール用厚膜フォトリソレジスト 等々、グレイスケールリソグラフィに纏わる各メーカーから最新ソリューションをご紹介 また希望者には実際に描画を行っていただけるワークショップも開催

◆日時

5月30日 (木) セミナー / 5月31日 (金) ワークショップ

◆場所

京都大学 国際科学イノベーション棟 5F 会議室, ナノハブクリーンルーム・加工評価室

◆主催

京都大学 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点

ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社

◆共催

GenISys 株式会社

◆概要

グレイスケールリソグラフィセミナー 2019年5月30日 13:30~18:00

- ・ハイデルベルグ・インストルメンツ株式会社
- ・GenISys 株式会社
- ・ナガセケムテックス株式会社
- ・京都大学 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点
- ・交流会

ハンズオンワークショップ 2019年5月31日 9:00~18:30

ステップ&スロープ・フレネルレンズといった3次元構造体を実際のレジストにグレイスケール描画を行います。

*5月30日セミナーのセッション終了後交流会を予定しています。

**5月31日ワークショップに参加の場合はクリーンルームウェア・クリーンシューズをご持参ください。お持ちでない方は事前にご相談ください。

◆定員

セミナーのみ 40名

セミナー及びワークショップ 10名

◆申し込み 以下の URL からお申し込みください。

URL: <https://www.himt-jp.com/events/gureisukerurisogurafiandowakushoppu>

◆備考

参加登録時にシステムの都合上"お支払へ進む"と表示されますが費用は発生しません。